サファイアへのNd添加による 新奇高機能レーザセラミック媒質の開発研究

理化学研究所 放射光科学研究センター 研究員 佐藤 庸一 (2020 年度 一般研究開発助成 AF-2020220-B3)

キーワード:レーザセラミックス、高熱伝導レーザ媒質、ネオジウム添加サファイア

1. 研究の目的と背景

レーザプロセッシングの適用分野と市場のさらなる拡 大には、レーザ装置の高輝度化と小型化が同時に達成され ることが必要である.このためにはレーザ媒質の単位体積 当たりからのレーザエネルギーの取出効率をより高める ことが要求されるが、レーザ発振に伴う余剰熱による利得 媒質の性能低下、変形、破壊などの熱問題により取出効率 は制限される.固体レーザ装置からの排熱特性はレーザ媒 質の熱伝導率をもとに設計されるため、より高い熱伝導率 を有するレーザ媒質を用いればレーザ装置の小型高輝度 化を進めることができる.

従来,高輝度出力レーザ装置のレーザ媒質には YAG 結晶 が多く用いられているが,排熱効率という観点からは室温 で10 W/mK という YAG の熱伝導率がボトルネックとなっ ている. このボトルネックを解消するための手段として, レーザ媒質を 150~200 K 程度に冷却することが提案され ている¹⁾. この温度領域では YAG の熱伝導率は 26 W/mK と なり排熱特性は改善されるが²⁾,別途液体窒素ベースの冷 却装置が必要であり,装置の小型化という観点からは望ま しくない. これに対し,筆者らのグループでは複合構造化 による YAG 実効熱伝導率の向上を提案している.サファイ アの熱伝導率は室温で 36 W/mK であるため,厚さ 0.5 mm の YAG 結晶の両端面に厚さ 2 mm のサファイア結晶を常温 接合してサンドイッチ構造を形成すれば実効熱伝導率は 室温でも 27 W/mK に向上される³⁾. これによりレーザ装置 の大幅な小型高輝度化がなされている⁴⁾.

サファイアに Nd³⁺イオンなどの希土類元素添加による レーザ活性を付加することができれば、高い光利得と高い 熱伝導率が両立された非常に優れたレーザ媒質になると 期待できる.しかしながら、サファイアにおける A1-0 の 原子間距離 1.97 Åよりも Nd³⁺と 0²⁻のイオン半径の和 2.36 Åの方が大きいため、希土類イオンの周囲に安定したサフ ァイアの結晶場を形成することは非常に困難である⁵⁾.実 際に、これまでに報告されている Nd:サファイアバルクの 分光スペクトルにおいては希土類特有の結晶場分裂によ る狭帯域な蛍光ピークは観察されていない⁶⁾.

本論文においては、Nd:サファイアレーザ媒質開発にお いて基盤技術となるサファイア結晶(コランダム構造の Al₂O₃)における Al³⁺サイトの希土類(Nd³⁺)置換の実現手 法について検討する.本研究が最終的に目指すところは、 レーザプロセッシングの適用分野と市場のさらなる拡大 に資するNd:サファイアレーザ装置の実現である.サファ イア結晶構造における希土類置換手法が確立されれば Nd³⁺添加Al₂O₃粉末を合成できるので,これを原料粉末と して配向制御することにより⁷⁾Nd:サファイアセラミック レーザを製造することが可能となる.

2. 研究方法

2・1 第一原理計算

サファイア (コランダム構造の Al₂0₃) に Nd³⁺を置換し た系がどのような状態であるかを調べるために, PBEsol 型の交換相関擬ポテンシャルを使用した PAW 法による第 一原理計算を行った⁸⁾. 電子系の自己無撞着計算にはソル バーとして Quantum Espresso Suite v6.5 を用いた⁹⁾.

計算評価項目は、Nd³⁺イオンを1個含むプリミティブセ ル(25 at.%に相当)からNdイオンを1個含む3x3x2スー パーセル(0.46 at.%に相当)までのAl₂0₃コランダム構造 に関し、Al³⁺とNd³⁺との単純置換による内部応力の状況、 Nd³⁺置換1個あたりの全電子エネルギー変化量とした.加 えて、Nd添加による安定構造がある場合はその構造につ いて推定した.

2·2 試料作製

易焼結性アルミナ粉末(AKP シリーズ,住友化学)に0.1 ~1.0at.%のNd³⁺添加量となるよう秤量した酸化ネオジ ム粉末(3NSP:U,信越化学工業)を加えてボールミルに より湿式粉砕混合し、スプレードライヤー(GB-210B,ヤ マト科学)で再粉末化する.これを一軸成形機(MP-100, ラボネクト)および成形圧力200MPaのCIP成形機(CPA50-200,エヌピーエーシステム)でタブレット形状に成形後, 電気炉(F0410,ヤマト科学)で600℃40時間の脱脂処理, さらに高温ボックス炉(KBF524N1,光洋サーモシステム) による大気圧焼成もしくはAr雰囲気189MPa・80分のHIP 処理(SYSTEM 20J,神戸製鋼)によりNd添加Al₂0₃コラン ダム構造の焼結体を得る.

2·3 試料評価

まず焼結後のタブレット形状試料表面について,走査型 電子顕微鏡(SEM)(JCM-7000,日本電子)を用いて微細構 造を観察するとともに,エネルギー分散型X線分光法(EDS) により試料内におけるNdの分布状況を調査する.

試料内の生成相については, θ-2θ法による粉末 X線回

折法(XRD)で評価した. XRD スペクトルは多目的オペラン ドX線回折装置(Empyrean, Malvern Panalytical)によ り、X線源にCu(波長1.5405 Å)を用い2 θ において7° ~70°の範囲で計測した.

さらに焼結試料を Nd イオンの 4f 電子遷移波長に相当 する 808 nm の半導体レーザ(LIMO40-F400-DL808, LIMO) で励起し,得られた蛍光のスペクトルを分光器(CT-100, 日本分光)と InGaAs アレイセンサ(iDus DU491A-1.7, Andor)を用い 0.4 nm の波長分解能で取得した.

3. 第一原理計算による物性評価結果

Nd³⁺イオンを1個含むプリミティブセル(25 at.%に相当)からNd³⁺イオンを1個含む 3x3x2 スーパーセル(0.46 at.%に相当)までのAl₂O₃ コランダム構造に関し,Al³⁺とNd³⁺との単純置換による内部応力を計算した.図1に示される通り,内部応力はNd³⁺添加濃度に対して比例しており,また発生する応力はプラスの圧縮応力のみで剪断ひずみは発生しない.c軸方向の応力はa軸方向の応力と6%程度しか違っておらず,内部の応力はほぼ等方的といえる.

次いで,Nd³⁺置換1個あたりの全エネルギー変化につい ての評価結果を図2に示す.このエネルギー変化は添加濃 度2.1at.%以下で一定となっているが,これはNd³⁺添加 により導入される結晶構造の歪みは,2x2x1スーパーセ ル相当のサイズ以上には広がっておらず,局所的な歪みだ





図1 サファイア中 Al³⁺の Nd³⁺置換による内部応力

図2 Nd 1 個あたりの全電子エネルギー変化

けで Nd³⁺を受容していることを意味する.これ以上の添加 濃度では,格子の歪みは複数の Nd³⁺イオンにより誘起され るためエネルギー変化はより大きくなると解釈できる.

この結果を踏まえ,2.1at.% (2x2x1 スーパーセル)に 1個のNd³⁺を含む状態について,第一原理計算による格子 ベクトル及び格子内部の原子座標最適化により求めた安 定構造をVESTAにより描画した結果を図3に示す.A1³⁺の c軸方向のいずれかの方向でA1³⁺が隣接していない隙間 があり,置換されたNd³⁺が隙間側に移動することにより, 局所的な変化のみで安定化構造が実現される.そのため, この安定化構造においては c軸方向の格子定数増加は +0.006%と変化はほぼ無い.また,a軸方向には0原子の 変位があるが,+0.7%の微小変化にとどまる.従って,こ の安定化構造においてはサファイアのコランダム構造に はほぼ変化が無いと言える.



図3 Nd 添加サファイアの安定な結晶構造.オレンジ, 灰,赤の各球は Nd, Al, 0のイオンである.

本章の結論として、Nd³⁺添加により誘起される内部応力 はほぼ等方的であるため、外部からの等方圧の印加でNd³⁺ 添加により応力を相殺し、Nd³⁺イオンを単純置換させてか らの構造緩和により安定構造を形成できる可能性がある. 固体レーザとしてのNd³⁺イオンの添加濃度は1x10²⁰/cm³程 度が目安であり、サファイアでは0.25 at%に相当する. Nd³⁺イオンを0.46 at.%添加した際の内部応力は1.7 GPa であり、添加濃度0.25 at%で発生する応力を完全に相殺 するためには外部からの1 GPa の等方圧印加が必要とな る.本論文における試料作成の際には 189 MPa の熱間等 方圧プレス装置を利用しているが、この程度の圧力でも Nd³⁺添加をある程度促進することができると期待できる.

4. 作成した試料の評価結果

4・1 SEM-EDS 評価

図4に1500℃で焼成した0.2 at.% Nd³⁺添加Al₂0₃の SEM 写真およびEDS による元素マッピング結果を示す.ま ず,大気圧焼成の場合,原料粉末の一次粒子(粒径200 nm 程度)は保存されず,粒径数µm 程度のグレインを形成し ているのに対し,HIP 焼成ではアルミナの一次粒子の形状 がそのまま保存されている.このことは,HIP 処理でNd³⁺ 添加を行う際に,原料粉末の焼結性を損なわず処理できる 可能性があることを示している.さらに,大気圧焼成の場 合には Nd³⁺は組織全体に分布はしておらず,局所的に存在 する異相に集中している(なお,この異相には Al³⁺イオン も含まれている).一方で,HIP 焼成においては,Nd³⁺は(多 少の偏析はあるが)組織全体に分布している.このことか ら,大気圧焼成と比較して,HIP 焼成条件下ではアルミナ マトリックスへの固溶度がより高くなっていると言える.



図4 0.2at.% Nd 添加 Al₂0₃の元素マッピング (a)1500℃大気圧焼成試料(b)1500℃HIP 焼成試料

4・2 XRD 評価

図5に焼成前および1500℃で焼成した0.2 at. %および 0.5 at. % Nd 添加 Al₂0₃の XRD スペクトルを示す. いずれ の Nd³⁺添加濃度においても、 α —アルミナ (サファイア) 由 来の回折ピークのみが観察されており、酸化ネオジウム粉 末からのピークは (低濃度のため)検出できていない.

焼成後の試料について、0.2 at. %添加の場合には、大 気圧焼成試料(図5中の青線)においてはサファイア相以 外にも多くの異相の回折ピークが出現しており、確認され ている異相成分としては、大気圧焼成試料については NdAl0₃、NdAl₁₁O₁₈ などのほかにも Nd_{0.825}Al_{11.71}O₁₉ などイン コメンシュレートな相も確認される.これに対し、HIP 処 理試料(図5中の黒線)は NdAl0₃のピークのみがわずかに 検出される程度で、サファイア相以外の異相については完 全ではないが生成がほぼ抑制されていることが判明した. 一方で、0.5 at.%の Nd 添加試料については、主に NdAl0₃ と推定される異相からの回折ピークが確認された.

このことから,1 GPaの1/5以下である189 MPaの等方 圧印加でも,Nd 添加濃度0.2 at.%程度以下であればNd³⁺ 添加を促進できることが明らかとなった.



(a) 0.2 at.% Nd 添加 (b) 0.5 at.% Nd 添加

4·3 分光評価

図6に1500[°]Cで大気圧焼成および HIP 処理を行って得られた 0.1at. % Nd 添加 Al₂0₃について,Nd³⁺イオンにおける ${}^{4}F_{3/2} \rightarrow {}^{4}F_{11/2}$ 遷移に対応した波長領域における蛍光 スペクトルを示す.ここで,文献 6)などで報告された従来の Nd³⁺添加 Al₂0₃とは異なり,明らかに結晶場分裂と思われる複数の蛍光ピークを観察することができる.しかしながら,大気圧焼成および HIP 処理のいずれの試料においても同様の蛍光プロファイルが得られた.大気圧焼成試料において Nd はほぼ異相部分に局在しているため,図5 で得られた蛍光は異相に含まれた Nd イオンから放出されたものであると考えられる.

異相生成の状況が Nd³⁺濃度に依存しているかどうかに ついて確認するため,Nd³⁺添加 Al₂O₃の蛍光スペクトルの Nd 濃度依存性について評価する.図7において示す通り, 1500℃大気圧焼成処理により得られた試料では,0.5at.% 以下の添加濃度とそれ以上の添加濃度で,蛍光プロファイ ルに大きな変化がみられる.XRD 評価の結果からは,HIP 処理試料及び Nd³⁺添加濃度が低い場合には異相の主成分 は NdA1O₃であり,それに対して Nd 添加濃度が 1at.%の場 合にはインコメンシュレート相である Nd_{0.825}Al_{11.71}O₁₉が異 相の主成分となっていて, NdA1O₃からの回折ピークは弱く なっている.ここで注意すべきは, Nd³⁺添加濃度が低い場 合波長 1090 nm などを中心とした非常に鋭い蛍光成分 (図7の↓で示したピーク)が観察されることである.こ の傾向のピーク波長は, MBE で作成された Nd³⁺添加 Al₂O₃の エピ成長膜からの蛍光のピーク波長と一致していた¹⁰⁾.



図6 0.1at.% Nd 添加 Al₂O₃の蛍光スペクトル



図 7 1500℃大気圧焼成処理により得られた Nd 添 加 Al₂O₃の蛍光スペクトルの Nd 濃度依存性

5. 考察およびプロセスの改善

5・1 プロセス改善のための検討

アルミナのコランダム構造に Nd³⁺が固溶しにくい以上, 低い添加濃度であるほど Nd は固溶しやすくなるはずであ る.このことから,図7において低添加濃度試料で観察さ れた1090 nm などを中心とした非常に鋭い蛍光ピークを 示す結晶相こそが我々が求める Nd³⁺添加サファイアであ ると考えられる.文献10)で採用されている MBE などの エピ成長によりプロセス用の大出力レーザ媒質合成は困 難であるため、以下では通常の焼成プロセスで Nd³⁺添加サ ファイアを合成するための手段について考える.

まず図2に示された第一原理計算結果では、Nd³⁺が高濃 度になるほどエネルギーが低くなっている.これはNd³⁺を 多く含む結晶相がより安定であることを示しており、焼成 処理において原子拡散距離が長くなるほどNd³⁺イオンが 凝集し異相を形成しやすくなることを意味している.一方 エピ成長では成長温度は高温ではなく、従って原子拡散距 離は非常に短い.また今回のNd³⁺源であるNd₂O₃粉末SP:U の一次粒子径は1 μ m程度であり、一方でAKPシリーズの Al₂O₃粉末の一次粒子径が数100 nm であるため、焼成開始 直後の原子拡散する前段階でのNd³⁺濃度は高く、異相を作 りやすい状況であったと考えられる.

以上の考察より、Nd³⁺がコランダム構造の中で安定化する前の段階でのNd³⁺リッチの異相生成抑制には

- (1) 原子拡散距離が短い低温で原料粉末を生成する
- (2) Nd₂0₃粉末の一次粒子径をAl₂0₃粉末より小さくする の二手法が有効であると考えられる.以下において, これらの改善策の有効性を検証する.

5・2 プロセス改善策の検証

原料粉末を作成後にレーザセラミックスへの焼成を行 うことを想定し、まずは焼成温度をアルミナ粉末の熱収縮 開始温度である 1050^{C5} 以下に設定する. 易焼結性 $A1_{2}0_{3}$ 粉末 AKP-53 に 0. 1at. %の $Nd_{2}0_{3}$ 粉末として SP:Uまたは一 次粒子径 15 nm 程度の 28097-34 (関東化学)を用い、1000^C で大気圧 180 時間もしくは 189 MPa HIP 処理4時間で焼 成し試料を得た. これらの試料からの蛍光スペクトルを図 8 に示す. 1000^Cで処理した試料からの蛍光はエピ成長膜 からの蛍光と一致する Nd 添加 $A1_{2}0_{3}$ の鋭いピークと、結晶 場からの影響を受けていない広帯域な波長範囲におよぶ



図8 1000℃焼成 Nd 添加 Al₂O₃の蛍光スペクトル

ブロードな蛍光からなっており,図6および7に示された 1500℃処理試料からの蛍光とは明らかに異なっていた. SP:U 添加の試料は大気圧焼成においては鋭い蛍光ピーク の強度はブロードな蛍光成分より弱いが,28097-34 添加 の試料は大気圧焼成においてもブロードな蛍光成分より 高い鋭い蛍光ピーク強度が得られた.なお Nd³⁺粉末の種類 によらず,HIP処理試料は大気圧焼成試料より Nd³⁺添加サ ファイア由来の鋭い蛍光ピークの強度が高かった.これら の結果から,焼成温度の低減と Nd³⁺原料粉末の一次粒径を 小径化,そして HIP 処理の適用が Nd³⁺イオンのコランダム 構造の格子サイトへの安定化促進に対していずれも有効 であることが示された.

5・3 ブロードな蛍光成分の起源について

Nd³⁺イオンが完全にコランダム構造の格子サイトへ置換されている場合,4f電子が結晶場の影響を受け,1000 nm領域の蛍光は12本以下の狭帯域なピークスペクトルを示す.しかしながら,図8におけるブロードな蛍光成分は結晶場分裂を示しておらず,従ってアモルファス相もしくはXRD検出限界以下で存在する結晶性の悪い相からの蛍光と考えられる.XRDスペクトル解析からは図8の蛍光を示す試料ではコランダム構造Al203からのXRDピークのみが検出されており,このこともブロードな蛍光成分が試料内のNd³⁺を格子サイトに含む良好な結晶相からの蛍光ではないことを裏付けている.

このブロードな蛍光を示す異相を低減するために, 添加 濃度 0.1at.%がコランダム構造の格子サイトへの安定化 に対する上限濃度を超えているかどうかを確認する必要 がある.まず,1050℃より高温での焼成試料においては, 図9で示される1200℃での1時間 HIP 処理を施した試料 の蛍光スペクトルにおいて見られる通り, 図8で計測され た NdA103 由来と推定される波長1057 nm の蛍光成分が現 れており, Nd³⁺イオンのコランダム構造の格子サイトへの 安定化が阻害されていることが理解できる.

その一方で,図9に示された1000℃120時間,1000℃180 時間,および900℃270時間の大気圧焼成で得られた試料



図9 Nd:Al₂O₃ 蛍光スペクトルの焼成条件依存性



図10 Nd₂O₃とNd:Al₂O₃の蛍光スペクトル比較

の蛍光スペクトルでは、焼成時間を長くしてもブロードな 蛍光成分に対する Nd³⁺添加 Al₂O₃相からの蛍光強度比はほ とんど変化していない.また、この蛍光強度比は 1000℃ での4時間 HIP 処理の試料よりも小さいが、オーダーとし てはほぼ変わらない.さらに、1050℃を超える温度で焼成 した試料においては、HIP 処理、大気圧焼成いずれの場合 においても、焼成温度が高くなるほどブロードな蛍光成分 に対する Nd³⁺添加 Al₂O₃相からの蛍光強度比は低下する. これらの図9に示された結果より、コランダム構造の Al 格子サイトに安定化される Nd イオンの比率は、1000℃で の4時間 HIP 処理で実現される以上の改善が現段階では 難しいことを示している.

図10にNd₂0₃粉末(焼成前試料)からの蛍光スペクト ルを示す.Nd₂0₃粉末からの蛍光はブロードではあるが,焼 成後の試料とは明らかに異なる蛍光強度の波長依存性を 示しており,焼成試料からのブロードな蛍光は組織内に残 留したNd₂0₃粉末成分から試料から放射されたものでは ないことが判明した.また図10においては,600℃での 大気圧焼成処理でもNd³⁺イオンのコランダム構造への置 換が進むことが示されている.なお,Nd₂0₃粉末からの蛍光 スペクトル形状は文献6)などで報告された従来のNd 添 加Al₂0₃と非常に近く,これらの試料における蛍光がコラ ンダム構造にきちんと固溶できていないNd³⁺イオンクラ スターからの蛍光であった可能性がある.

5・4 ブロードな蛍光を発する異相の生成量について

添加したコランダム構造の格子サイトに安定化される Nd³⁺イオンの比率がほぼ100%ではない場合,Nd³⁺添加濃度 を 0.1 at.%より高くしただけ固溶しきれないNd³⁺の個数 が増加するはずであり,その場合ブロードな蛍光成分に対 する Nd³⁺添加 Al₂O₃ 相からの蛍光強度比は Nd³⁺添加濃度に 反比例するはずである.ところが,図11で示される通り, 1000℃での4時間 HIP 処理で得られた0.2at.% Nd³⁺添加 Al₂O₃ 試料におけるブロードな蛍光成分に対する Nd³⁺添加 Al₂O₃ 試料におけるブロードな蛍光成分に対する Nd³⁺添加 Al₂O₃ 積からの蛍光強度比は,0.1 at.% Nd 添加 Al₂O₃ 試 料のほぼ倍となっている.



図11 1000℃での HIP 処理により得られた Nd 添 加 Al₂O₃の蛍光スペクトルの Nd 濃度依存性

なお、励起用半導体レーザの発振波長はNd:サファイア の吸収ピーク825 nm¹⁰からずれており、一方でブロード な蛍光を示すNd³⁺イオンは吸収帯域もブロードである.こ のため励起光のエネルギーの大部分は異相の励起に費さ れ、励起光成分のごく一部しかNd³⁺添加Al₂O₃中のNd³⁺イ オンを励起できないと考えられる.従って、図8~図11 に示されたブロードな蛍光成分は実際の蛍光量より強調 されたものである可能性がある.

これらのことから,図9の試料においては Nd³⁺の大部分 はサファイアに固溶できており,ブロードな蛍光成分を示 す異相の生成量は非常に少ないと期待される.

5・5 ブロードな蛍光成分の抑制見込みについて

励起波長を825 nm に近づければ蛍光スペクトルにおけ るブロードな蛍光成分は低減できる.しかしながらこれは 本質的な解決策ではなく,まずはブロードな蛍光を発する 異相の生成を抑制する必要がある.

具体的な異相の生成状況について、図12に 1000℃での HIP 処理により得られた Nd³⁺添加 Al₂O₃の EDS 元素マッ ピングを示す.Nd³⁺イオンについては組織全体に均一に分 布しており、図4で示されたような分布量のムラは見られ なかった.しかし、Y, Gd, Lu などを主成分とする異相が 局所的に分布しており、これがブロードな蛍光の放射源と なっていると考えられる.これらの不純物は原料粉末由来 ではなく、プロセス機器(具体的には篩)を他実験と共用 したことにより混入されたものである.

この結果から、プロセス中の不純物混入を防止すること により、ブロードな蛍光を発しない理想的なNd³⁺添加Al₂O₃ 粉末が合成できると考えられる.

6. 結論

サファイア Al³⁺サイトにおける希土類 Nd³⁺置換について



図12 1000℃での HIP 処理により得られた Nd 添 加 Al₂O₃の EDS 元素マッピング

- (1) 1050℃より低温で焼成処理する
- (2) 熱間等方圧プレスを利用する
- (3) Nd₂O₃ 原料粉末の一次粒子径を小さくする
- (4) プロセスにおける不純物混入を防止する

が有効であることが示された¹¹⁾. この手法でNd添加Al₂O₃ 粉末を合成し,これを原料粉末としてNd:サファイアセラ ミックレーザを製造することにより,レーザプロセッシン グの適用分野と市場を拡大できると期待される.

謝 辞

XRD 計測は文部科学省「マテリアル先端リサーチインフ ラ」事業(課題番号 JPMXP1223MS1052)の支援を受け自然 科学研究機構分子科学研究所で実施された. 試料作製には 理化学研究所の松田美帆氏に協力いただいた.

参考文献

- 1) P. Mason et al. : Optica 4 (2017) 438.
- 2) Y. Sato, T. Taira: ASSL 2024 / Optica Laser Congress 2022, Barcelona, Spain (2022) ATh1A.8.
- Y. Sato, T. Taira : TILA-LIC2024, OPIC2024, Yokohama, Japan (2024) TILA-LIC8-04.
- L. Zheng et al. : Opt. Mater. Express 7 (2017) 3214.
- 5) 浜野健也他:窯業協会誌, 87 (1979) 633.
- E. H. Penilla et al. : Light Sci. Appl. 7 (2018) 33.
- 7) Y. Sato et al. : Sci. Rep. **4** (2017) 10372.
- 8) A. Dal Corso: Comp. Mater. Sci. **95** (2014) 337.
- P. Giannozzi et al. : J. Phys. Condens. Matter
 29 (2017) 465901.
- 10) R. Kumaran et al. : Opt. Lett. 34 (2009) 3358.
- 佐藤庸一, 平等拓範:第71回応用物理学会春季学術 講演会(2024) 24a-13P-13.